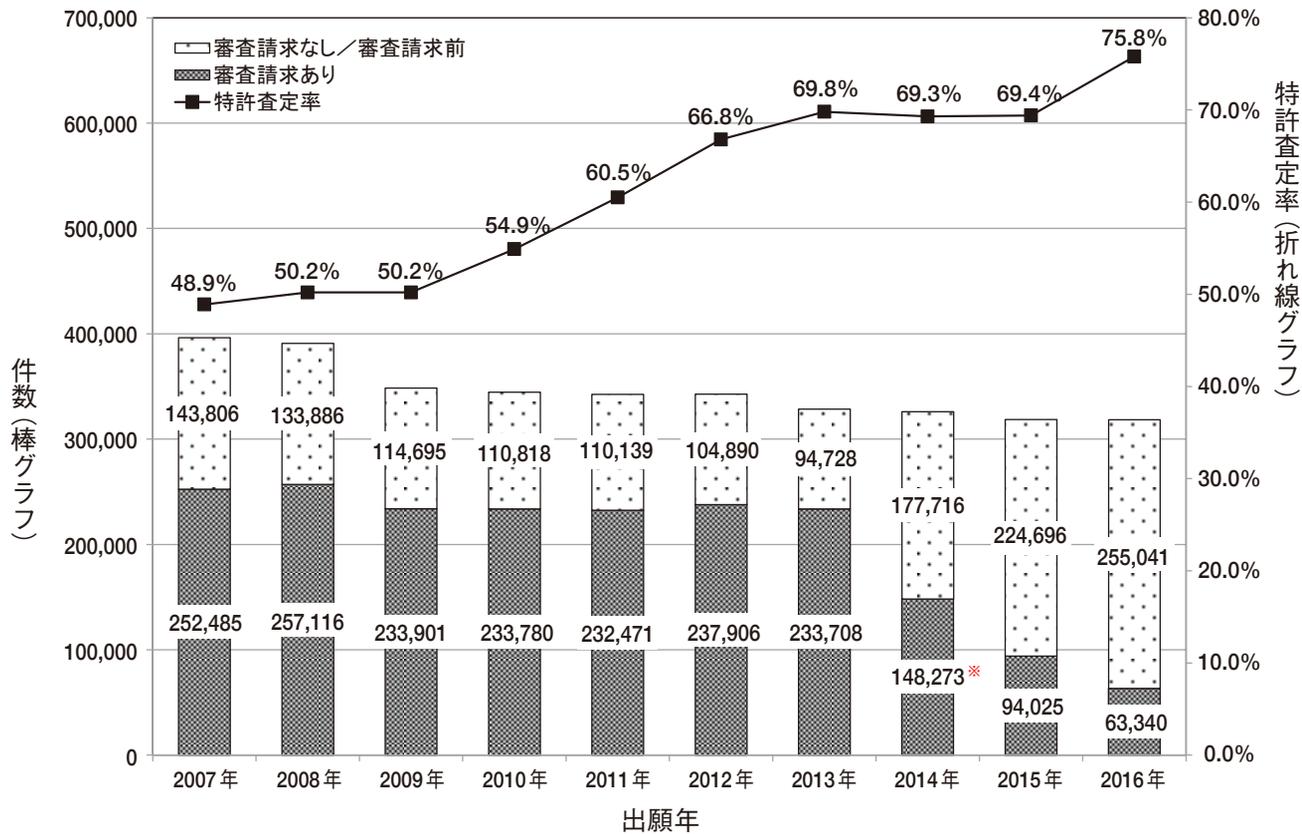


《図2：日本における審査請求件数（出願年ベース）および特許査定率の推移^{(1),(3)}》



※後日に公表された「特許庁ステータスレポート2018」での件数は233,963

さらに、図2からは、全出願件数の減少が続く中で審査請求件数の推移は2009年以降横ばいであることがわかります（注：2014～2016年の出願は審査請求期間を満了していないため、件数が少なくなっています）。

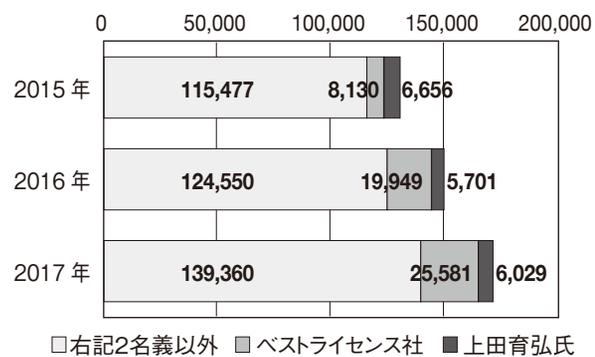
登録件数（図1の全登録）については、増加が続いていたものの2013年をピークに減少し徐々に落ち着く気配を見せています。その一方で、表1及び図2からわかるように、審査期間は短縮傾向が続いており、数年は落ち着いていた特許査定率は2016年に+6.4ポイントの大幅な上昇を示しました。

《表2：日本の商標登録出願件数・登録件数^{(1),(2)}》

	全出願	分割出願	全登録
2013年	117,674	684	103,399
2014年	124,442	1,921	99,896
2015年	147,283	9,470	98,085
2016年	161,859	18,729	105,207
2017年(速報値)	190,412*	データなし	111,180

※後日に公表された「特許庁ステータスレポート2018」での件数は190,939

《図3：日本における公開商標公報件数^{(4),(5)}》



注) 出願日から2～3週間程度を目安に公報が発行される運用のほか、一部未蓄積又は照会不可のデータがあるため、表2の全出願件数は図3の公報件数の合計と一致しません。

(2) 商標登録出願件数が増加している背景は？

日本における商標登録出願件数の増加は一般紙でも報じられているところですが、同時に話題になっているのが「一部の出願人(ベストライセンス社および上田育弘氏)」による大量出願です。その現状を示しているのが表2及び図3で、2017年は当該「一部の出願人」名義による公開商標公報（注：出願があったことを公開するもので、審査を経て設定登録され、商標権が発生したことを示すものではありません）の件数は全体の18%を占めていますが、その分を差し引いても、公報の件数は増加していることがわかります。

なお、当該「一部の出願人」は、大量の分割出願を行っていることや、これまでに取得した商標権が極めて少ないこと(2018年2月時点で6件)⁽⁶⁾がわかっていますが、表2に示される分割出願と全登録の件数はその事実を明らかにしています。

2018年2月27日に国会に提出された商標法改正案では、「商標出願手続の適正化」のための措置として、分割出願(第10条)の制限に関する改正事項が含まれていることから、今後の動向が注目されます。

3 中国

(1) 特許出願件数は急増が続いている？

前号⁽⁷⁾でも紹介したとおり、近年、中国における特許(中国専利法における発明専利)の出願件数は増加の一途にあります。前号で掲載したデータは2016年までですが、中国国家知識産権局(SIPO;日本の特許庁に相当する官庁で特許・実用新案・意匠を管轄)は、2017年の特許出願件数をすでに公表⁽⁸⁾しており、138.2万件で、対前年比+14.2%と引き続き高い伸びを示しています。

SIPOはウェブサイトでも正確な件数も公表⁽⁹⁾しており、そこでの公表値は、2016年が1,338,503件で、2017年が1,381,594件とあります。しかし、これらの公表値で対前年比を計算すると+3.2%となり、出典⁽⁸⁾での対前年比+14.2%と一致しません。

この不一致の原因は、2017年2月23日付けでのSIPOによる発表⁽¹⁰⁾から読み取ることができます。その発表の内容とは、出願件数の公表値を「受理量」から「申請量」に変更したというもので、そこで気になるのは2つの量が示す意味ですが、次のような違いがあります。

- ・「受理」= 特許庁が受理したのみ

- ・「申請」= 受理かつ初期費用の納付があり、方式審査に入る前の状態

つまり、2017年からは初期費用の納付がない出願を件数から除外したということになります。そこで、2017年の対前年比を基に2016年の件数を申請量に補正すると、表3の推定値となり、2016年は特許出願の受理量と申請量との間に次のような差があった推定できます。

$$1,338,503(\text{受理量}) - 1,209,805(\text{申請量}[\text{推定}]) = 128,698[\text{件}]$$

この差は2016年における受理量の9.6%にあたり、相当な数の特許出願は、出願日が認定された後に初期費用が納付されることなくみなし取下げ(専利審査指南第5部分第2章1(1))となったこととなります。これだけの件数がみなし取下げとなった背景の分析についてSIPOからの発表は確認できませんでしたが、実務面から考えられる可能性としては、例えば、優先権の基礎を確保すること(中国専利法の国内優先権制度では、後の出願時における先の出願の係属状態は要件になっていません)を目的として出願後に初期費用を納付しなかった場合が考えられるようです。

ちなみに、米国では、特許(utility patent)の本出願(nonprovisional application)とは別に、その30%弱の件数にあたる仮出願(provisional application)があります(表3参照)。庁料金(\$280 [large entityの場合、2018年2月現在])の支払いは必要ですが、米国仮出願は優先権の基礎(先の出願日の利益)を得ることが主目的の出願です。米国では審査請求制度がないこと等を考慮する必要はあるものの、仮に、中国において初期費用未納付の多くは優先権の基礎の確保が目的だとしたら、2016年における受理量の9.6%という件数は必ずしも多いとは言えないのかも知れません。

《表3：中国および米国における特許(発明専利、Utility、Provisional)出願件数^{(9),(11)}》

		2016年	2017年
中国 発明専利	受理量	1,338,503 [公表値]	非公表
	申請量	1,209,805 [推定値]	1,381,594 [公表値] (対前年比:+14.2%)
米国 Patent	Utility	607,753	602,354 [速報値] (対前年度比:-0.9%)
	Provisional Applications	167,390	166,744 [速報値] (対前年度比:-0.4%)

*米国は2016年度(FY2016=2015年10月~2016年9月)および2017年度(FY2017=2016年10月~2017年9月)のデータ

《表4：中国および日本における商標登録出願件数・区分数^{(12),(13)}》

		2012	2013	2014	2015	2016
中国 (SAIC 公表値)	出願件数	1,648,316 (+16.3%)	1,881,546 (+14.1%)	2,285,358 (+21.5%)	2,876,048 (+25.8%)	3,691,365 (+28.3%)
	区分数	1,647,511 (+16.5%)	1,878,384 (+14.0%)	2,220,703 (+18.2%)	2,828,083 (+27.3%)	3,697,916 (+30.7%)
中国 (WIPO 公表値)	出願件数	1,618,431 (+16.7%)	1,847,936 (+14.2%)	2,104,409 (+13.9%)	データなし	データなし
	区分数	1,647,511 (+16.5%)	1,878,384 (+14.0%)	2,220,703 (+18.2%)	2,828,083 (+27.3%)	3,697,916 (+30.7%)
日本 (WIPO 公表値)	出願件数	119,265 (+11.4%)	116,139 (-2.6%)	124,617 (+7.3%)	144,857 (+16.2%)	162,984 (+12.5%)
	区分数	217,260 (+16.0%)	204,956 (-5.7%)	241,325 (+17.7%)	344,946 (+42.9%)	451,320 (+30.8%)

*2017年の中国(SAIC 公表値)は574.8万件と発表されています。

* () 内は対前年比

(2) 商標登録出願件数の急増は法改正も一因？

中国において、特許を上回る勢いで出願件数が急増しているのが商標登録出願です。これについては、特に2014年以降の急増の一因として、2014年5月1日施行の改正商標法により一商標多区分制が導入された後、中国国家工商行政管理総局商標局(SAIC CTMO；商標を管轄する官庁)が区分数を出願件数として公表している可能性を挙げることができます。

このことは、世界知的所有権機関(WIPO)が国毎に公表している統計⁽¹⁴⁾において、商標出願(Trademark Applications)の欄での内国人(Resident)の件数が2015年は空白、2016年は45件と異常な数値となっていることから推察できます。また、表4ではWIPO提供の別ツール⁽¹³⁾から得られるデータ(Indicatorとして「1 - Total trademark applications (direct and via the Madrid system)」及び「5 - Class count in total applications (direct and via the Madrid system)」を選択)も示していますが、件数は一致しないものの、SAIC公表の出願件数がWIPO公表の区分数に近い数値であることが分かります。

なお、出願件数および区分数のいずれについても、中国は日本を大きく上回っていますが、区分数の対前年比については、前述の「一部の出願人」の影響か、2015～2016年は日本が上回っています(ちなみに、日本の出願件数も、表2の件数とは一致していません)。

4 おわりに

今回は、統計的な事実を掘り下げてみると得られる気づきをご紹介しました。日本および中国における特

許・商標の現状を理解するためのご参考となれば幸いです。

【出典】 ※いずれもウェブサイトより入手可能

- (1) 日本特許庁「特許行政年次報告書2017年版」
- (2) 日本特許庁「特許出願等統計速報」
- (3) IP5 Offices「IP5 Statistics Report 2016 Edition」
- (4) 日本特許庁「公報発行予定表」、「公報に関して：よくあるご質問」
- (5) 知財ラボ「公開商標公報ランキング」
- (6) 弊所ウェブサイト・知財トピックス(日本情報)「特許庁、『手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について(お知らせ)』を公表」
- (7) 季刊創英ヴォイス vol. 81「データで見る中国における知的財産権の現状～特許権侵害訴訟の近況を交えて～」
- (8) 中国国家知識産権局「SIPO: Invention Patent Applications Surge in 2017」
- (9) 中国国家知識産権局「国家知识产权局专利业务工作及综合管理统计月报」
- (10) 中国国家知識産権局「国家知识产权局对专利统计数据公开内容进行调整」
- (11) 米国特許庁「Performance & Accountability Report」
- (12) 中国国家工商行政管理総局「Annual Development Report on China's Trademark Strategy 2016」
- (13) 世界知的所有権機関「WIPO IP Statistics Data Center」
- (14) 世界知的所有権機関「Statistical Country Profiles」

※この記事に関するお問い合わせ先：

知財情報戦略室：ipstrategy@soei-patent.co.jp